WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentkiassifikation 4:

H05K 3/34, 3/02

(11) Internationale Veröffentlichungsnammer: WO 86/ 06243

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

23. Oktober 1986 (23.10.86)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE86/00165

(22) Internationales Anmeldedatum: 15. April 1986 (15.04.86)

31) Prioritätsaktenzeichen:

P 35 14 093.3

32) Prioritätsdatum:

16. April 1985 (16.04.85)

33) Prioritātsland:

DE

71)(72) Anmelder und Erfinder: EIDENBERG, Kaspar [DE/DE]; Barbarastrasse 18, D-5241 Gebhardshain

74) Aswalt: BERKENFELD, Helmut; An der Schanz 2, D-5000 Köln 60 (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europăisches Patent), CH (europăisches Patent), DE (europăisches Patent), FR (europăisches Patent), GB (europăisches Patent), IT (europăisches Patent), LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europaisches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: PROCESS FOR THE CLOSING UP OF DRILL HOLES PROVIDED FOR IN A PRINTED CIRCUIT

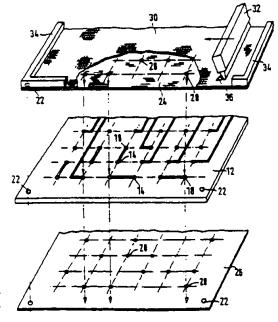
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM VERSCHLIESSEN VON IN EINER LEITERPLATTE VORGESEHENEN **BOHRUNGEN**

57) Abstract

Closing up of passive drill holes (14, 18) provided for in a printed circuit board (12). To this effect a mask (24, 26) with creen (30) is laid on the printed circuit board that has been drilled brough. At the points corresponding to the drill holes (14) that are o be filled, the mask (24, 26) has holes (28). With a doctor blade 32) solder fill varnish (36) is pressed through the holes in the screen (30) and in the mask (24) into the drill holes (18) as is done in the screen printing process. This pressing of the solder fill varnish into the drill holes (18) can be reinforced through the application of negative pressure from below on the printed circuit board (12).

(57) Zasammenfassung

Verschliessen der in einer Leiterplatte (12) vorgesehenen passiven Bohrungen (14, 18). Hierzu wird auf die gebohrte Leiterplatte eine Maske (24, 26) mit einem Sieb (30) aufgelegt. An den Stellen der zu verschliessenden Bohrungen (14) weist die Maske (24, 26) Löcher (28) auf. Mit einem Rakel (32) wird wie im Siebdruckverfahren Lötstoplack (36) durch das Sieb (30) und die in der Maske (24) vorgesehenen Löcher (28) in die Bohrungen (18) hineingedrückt. Dieses Hineindrücken des Lötstoplackes in die Bohrungen (18) kann durch Anlegen eines Unterdruckes an die Unterseite der Leiterplatte (12) verstärkt werden.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT AU BB BE BG BR CF CG CH CM DE DK FI	Österreich Australien Barbados Belgien Bulgarien Brasilien Zentrale Afrikanische Republik Kongo Schweiz Kamerun Deutschland, Bundesrepublik Dänemark Finnland	FR GA GB HU IT JP KP KR LI LU MC MG	Frankreich Gabun Vereinigtes Königreich Ungarn Italien Japan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Liechtenstein Sri Lanta Luxemburg Monaco Madagastar	ML MR MW NL NO SD SE SN SU TO US	Mati Manritanien Malawi Niederlande Nowegen Ruminien Sudan Schweden Schweden Sowiet Union Tschad Togo Vereinigte Staaten von Amerika
--	---	--	---	--	--

٠

Verfahren zum Verschließen von in einer Leiterplatte vorgesehenen Bohrungen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verschließen von in einer Leiterplatte vorgesehenen Bohrungen mit Auftragen eines Lötstoplackes auf mindestens eine Seite der Leiterplatte.

Leiterplatten, auf denen gedruckte Schaltungen ausgebildet werden, sind bekannt. Diese Leiterplatten weisen aktive und passive Bohrungen auf. In die aktiven Bohrungen werden die Bauelemente eingesetzt. Diese werden mit Lot elektrisch angeschlossen. Dadurch werden die aktiven Bohrungen vakuumdicht verschlossen. Die passiven Bohrungen dienen zum elektrischen Verbinden der einen mit der anderen Seite der Leiterplatte. Man bezeichnet sie auch als Umsteiger von der einen zur nächsten Ebene. Hierzu bleiben die passiven Bohrungen offen. Sie werden nicht mit Lot verschlossen. Die elektrische Verbindung von der einen zur anderen Seite der Leiterplatte erfolgt dabei zum Beispiel mit der sogenannten Durchmetallisierung.

Die fertigen bestückten Leiterplatten werden auf verschiedene Weise geprüft. Bei einem modernen Prüfverfahren werden die Leiterplatten mit Unterdruck in einen Adapter gezogen und durch den Unterdruck in diesem gehalten. Dieser Unterdruck wird durch die offen gebliebenen passiven Bohrungen zerstört. Zum Anwenden dieses Prüfverfahrens müssen daher auch die passiven Bohrungen geschlossen werden.

Man hat versucht, die passiven Bohrungen auf einer Lötwelle

zu schließen. Dabei können sich jedoch zwischen einem Lötauge und einer angrenzenden Leiterbahn kleine Zinnperlen
festsetzen. Dadurch kann unter einem Bauelement ein Kurzschluß entstehen. Dieses Verfahren hat daher starke Nachteile.

Man hat weiter versucht, die Bohrungen mit einer Lötstopmaske aus einer Fotopolymerschicht geschlossen zu halten. Hierzu beläßt man diese Schicht in gespanntem Zustand über den Bohrungen. Unter Lötstopmaske ist dabei eine Schicht aus einem sogenannten Lötstoplack zu verstehen. Ein Lötstoplack ist ein Lack, der nach einem bestimmten Muster auf eine Leiterplatte aufgebracht wird. Er verhindert das Anhaften von Lot. Das Verschließen der Bohrungen mit einer Fotopolymerschicht ist jedoch ein sehr teures Verfahren.

Von diesem Stand der Technik ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Verschließen von Bohrungen in einer Leiterplatte zu finden, das sich sicher und kostengünstig durchführen läßt. Die Lösung für diese Aufgabe ergibt sich nach der Erfindung dadurch, daß die Bohrungen mit einem Pfropfen aus dem schon genannten Lötstoplack verschlossen werden. Zweckmäßig wird dieser Lötstoplack im Siebdruckverfahren aufgebracht. Im Siebdruckverfahren besitzt man große Erfahrung, und es läßt sich kostengünstig durchführen.

In der praktischen Verwirklichung der Erfindung ist vorgesehen, daß eine erste Maske mit einem der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen entsprechenden Lochmutster und einem Sieb auf der von der Leiterplatte abgewandten Seite auf diese aufgelegt, der Lötstoplack aufgebracht und mit einem Rakel in die Bohrungen hineingedrückt wird. Dabei sollte der Durchmesser der in der ersten Maske vorgesehenen Löcher etwas über dem Durchmesser der zu verschließenden Bohrungen liegen. Das für die Pfropfen ge-

wünschte oder erforderliche Volumen läßt sich mit der Stärke der ersten Maske einregeln. Bei ansteigender Stärke steigt das Volumen der Pfropfen und umgekehrt.

Die Schneiligkeit und das Ausmaß, mit denen der Lötstoplack in die zu verschließenden Bohrungen eindringt, läßt sich erfindungsgemäß durch Anlegen eines Unterdruckes auf die andere Seite der Leiterplatte erhöhen. Hierzu wird im einzelnen vorgeschlagen, daß eine zweite Maske mit einem der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen entsprechenden Lochmuster auf die andere Seite der Leiterplatte aufgelegt und ein Vakuum angelegt wird und damit das Hineindrücken des Lötstoplackes in die Bohrungen von der einen Seite unterstützt wird.

Das für den erfindungsgemäßen Siebdruck verwendete und auf die erste Maske aufgebrachte Sieb muß sehr grobmaschig sein. Der Lötstoplack soll weiter eine hohe Thixotropie aufweisen. Damit wird sichergestellt, daß er ausreichend schnell und tief in die zu verschließenden Bohrungen eindringt. Die Menge des Lötstoplackes wird so eingestellt, daß er mindestens die halbe Tiefe der Bohrung ausfüllt. In einer Weiterbildung kann das erfindungsgemäße Verfahren auch von den beiden Seiten der Leiterplatte aus angewendet werden. Hierbei werden die Bohrungen von jeder Seite zur Hälfte gefüllt und damit vakuumdicht verschlossen.

Am Beispiel der in der Zeichnung gezeigten Ausführungsform wird das erfindungsgemäße Verfahren nun weiter beschrieben. In der Zeichnung ist:

- Fig. 1 eine perspektivische Teilansicht einer fertigen Leiterplatte,
- Fig. 2 eine auseinandergezogene perspektivische Darstellung einer Leiterplatte während ihrer Herstellung, der

von oben auf sie aufzulegenden ersten Maske mit Sieb und Rakel und der von unten an sie anzulegenden zweiten Maske,

- Fig. 3 eine Teildarstellung, teilweise im Schnitt, durch die Leiterplatte während ihrer Herstellung beim Aufbringen des Lötstoplackes,
- Fig. 4 eine Darstellung entsprechend Fig. 3 mit zusätzlicher Verwendung der zweiten Maske auf der Unterseite der Leiterplatte und Anlegen eines Vakuums und
- Fig. 5 in vergrößertem Maßstab die Darstellung eines Gebietes aus Fig. 5 zur besseren Verdeutlichung der Verfahrensvorgänge.

Fig. 1 zeigt vereinfacht eine Leiterplatte 12 mit ihren offen bleibenden Bohrungen 14. In diese werden die Anschlüsse
der schematisch dargestellten Bauteile 16 eingesteckt. Fig.
1 zeigt weiter die zu verschließenden Bohrungen 18. Zwischen
diesen verlaufen die Leiterbahnen 20. Die Bohrungen 18 sind
durchmetallisiert. Damit kann der Strom von einer Leiterbahn
auf der Oberseite zu einer Leiterbahn auf der Unterseite der
Leiterplatte 12 fließen. In den Ecken der Leiterplatte 12
sind noch Paßbohrungen 22 vorgesehen. Mit diesen wird sie
bei ihrer Fertigung in der richtigen Lage gehalten.

Fig. 2 zeigt die gleiche Leiterplatte 12 während ihrer Herstellung. Sämtliche Bohrungen sind noch offen. Über der Leiterplatte 12 befindet sich die obere erste Maske 24. Unter der Leiterplatte 12 befindet sich die wahlweise anzulegende untere zweite Maske 26. Beide Masken 24 und 26 weisen dort, wo sich die zu verschließenden Bohrungen 18 befinden, Löcher 28 auf. Unmittelbar auf der oberen Maske 24 befindet sich das Sieb 30. Fig. 2 zeigt weiter den Rakel 32. Er ist innerhalb des Rahmens 34 verschiebbar. Der Lötstoplack, der

durch den Rakel 32 in die zu verschließenden Bohrungen 18 gedrückt wird, ist bei 36 angedeutet. In der Leiterplatte 12 sind sowohl die Bohrungen 14 als auch die Bohrungen 18 noch offen.

Fig. 3 zeigt die Ausübung des Verfahrens. Die Leiterplatte 12 liegt auf einer Unterlage 38. Auf der Leiterplatte liegen die obere Maske 24 mit den Löchern 28 und das Sieb 30 auf. Eingezeichnet ist weiter die Durchmetallisierung 40 sowohl der offenen Bohrungen 14 als auch der zu verschließenden Bohrungen 18. Im Betrieb wird der Rakel 32 in Richtung des eingezeichneten Pfeiles über das Sieb 30 geschoben. Dabei drückt er den vor ihm befindlichen Lötstoplack 36 durch die Maschen des Siebes 30 und durch die in der oberen Maske 24 vorgesehenen Löcher 28. Diese befinden sich genau über den zu verschließenden Bohrungen 18. Wie dies für die rechts liegende Bohrung 18 angedeutet ist, ist ein Pfropfen 42 aus Lötstoplack in diese hineingedrückt worden. Er füllt etwa die halbe Höhe der Bohrung 18 auf. In der weiter links liegenden Bohrung 18, über der sich gerade der Lötstoplack 36 befindet, hat der Pfropfen 42 noch nicht diese Länge erreicht. Bei Verwendung eines thixotropen Lötstoplackes ist dieser beim Hineindrücken in die Bohrung 18 noch flüssig.Dies erleichtert sein Eindringen in die Bohrung 18. Durch den durch den Rakel 32 ausgeübten Druck werden die obere Schablone 28 mit dem Sieb 30 vor und hinter dem Rakel 32 etwas angehoben. Nur unter dem Rakel 32 liegen sie unmittelbar auf der Leiterplatte 12 auf.

Falls Pfropfen 42 mit einer Länge von etwa der halben Höhe der Leiterplatte 12 nicht zum Verschließen der Bohrungen 18 ausreichen, kann das Verfahren, wie vorstehend angegeben, auch von der anderen Seite, das heißt von unten, ausgeführt werden. Ebenso läßt sich das Eindringen der Pfropfen 42 in die Bohrungen 18 durch das Anlegen eines Unterdruckes an die untere Seite der Leiterplatte 12 verbessern.

Dies zeigt Fig. 4. Die Oberseite der Unterlage 38 ist gerieft. Kanäle 44 treten durch die Unterlage 38 durch. Die bereits erwähnte zweite Maske 26 liegt auf der gerieften Oberseite der Unterlage 38 auf. An den zu verschließenden Bohrungen 18 weist sie Löcher 28 auf. Die Kanäle 44 sind an eine Unterdruckquelle angeschlossen. Über die Riefen in der Oberseite der Unterlage 38 pflanzt sich dieser bis zu den Löchern 28 in der zweiten Maske 26 und damit bis in die zu verschließenden Bohrungen 18 fort. Wenn nun der Rakel 32 über das Sieb 30 fährt und den Lötstoplack 36 in die Bohrungen 18 drückt, werden die sich bildenden Pfropfen 42 zusätzlich durch den Unterdruck nach unten gezogen. Man erkennt, daß der in Fig. 4 rechts befindliche Pfropfen 42 länger als sein Gegenstück in Fig. 3 ist.

Fig. 5 zeigt in größerem Maßstab den Teilbereich aus Fig. 4, der sich am und etwas links vom Rakel 32 befindet. Die sich auf diesen Teil beziehende Beschreibung von Fig. 4 gilt auch für Fig. 5.

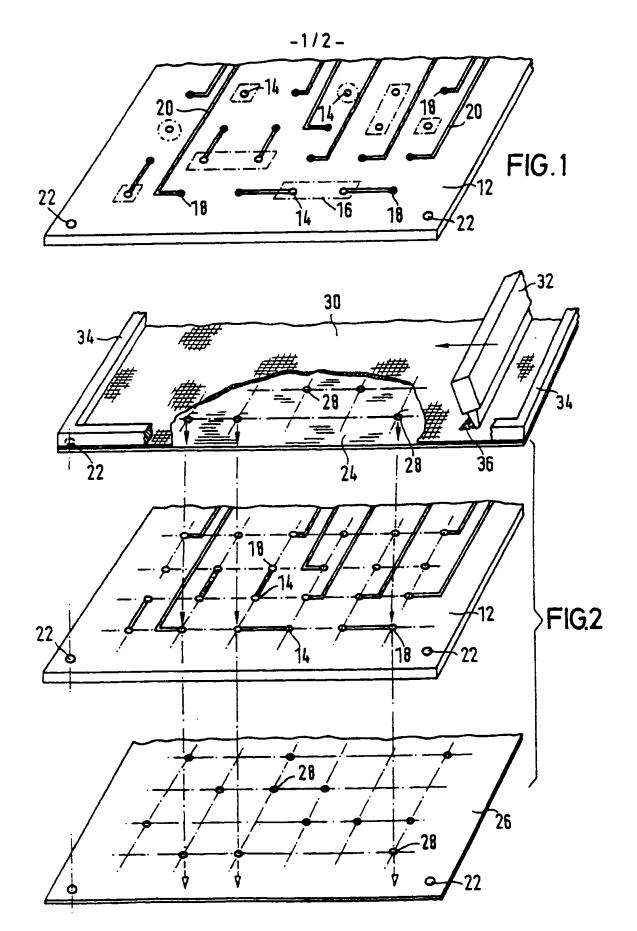
Die Abmessungen und die räumliche Zuordnung der verschiedenen Teile in der Skizze sind nur schematisch und nicht maßstäblich zu verstehen. - 7 -

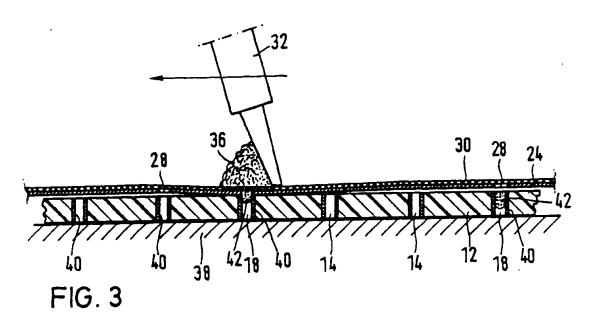
Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Verschließen von in einer Leiterplatte vorgesehenen Bohrungen mit Auftragen eines Lötstoplackes auf mindestens eine Seite der Leiterplatte, dadurch gekennzeichnet, daß die Bohrungen mit einem Pfropfen aus Lötstoplack verschlossen werden.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Lötstoplack im Siebdruckverfahren aufgebracht wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Maske mit einem der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen entsprechenden Lochmuster und einem Sieb auf der von der Leiterplatte abgewandten Seite auf diese aufgelegt, der Lötstoplack aufgebracht und mit einem Rakel in die Bohrungen hineingedrückt wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser der in der ersten Maske vorgesehenen Löcher etwas über dem Durchmesser der zu verschließenden Bohrungen liegt.
- 5. Verfahren nach Anspruch l bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Stärke der ersten Maske nach Maßgabe des für die Pfropfen gewünschten Volumens ausgewählt wird.
- 6. Verfahren nach Anspruch l bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine zweite Maske mit einem der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen entsprechenden Lochmuster auf die andere Seite der Leiterplatte aufgelegt und ein Vakuum angelegt wird und damit das Hineindrücken des Lötstoplackes in die Bohrungen von der einen Seite un-

terstützt wird.

- 7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Lötstoplackes mit einer hohen Thixotropie.
- 8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß es auf den beiden Seiten der Leiterplatte angewendet wird.





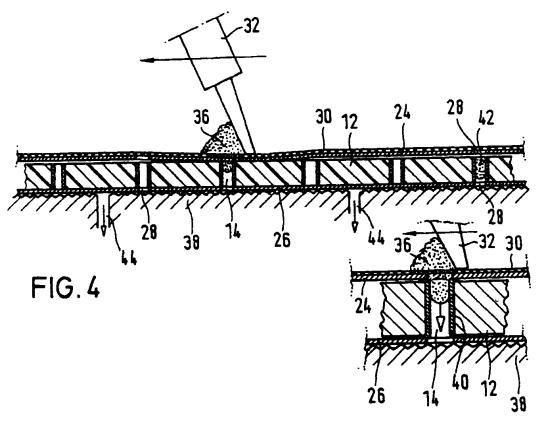


FIG. 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/DE 86/00165

	L CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (II several classification symbols apply, indicate all) *				
According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC					
	1. ⁴ : H 05 K 3/34; H 05 K 3/02				
IL FIELD	S SEARCHED				
	Minimum Decume	ntation Searched 7			
Classificat	ion System	Classification Symbols			
Int. (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Documentation Searched other to the Extent that such Documents	han Minimum Documentation are included in the Reids Searched ⁹			
III. DOC	UMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	18	Relevant to Claim No. 15		
Calegory *	Citation of Document, 11 with Indication, where appr	reprists, of the relevant passages "	TABLE IS SIDE. NO.		
x	FR, A, 2551618 (COMPAGNIE D'INFORMA SPATIALE ET AERONAUTIQUE) 8 M line 16 - page 5, line 13; figure 1	ATIQUE MILITAIRE farch 1985, see page 4,	1,2		
A	_		3,5		
A	US, A, 4478882 (ITALTEL SOCIETA ITAL TELECOMMUNICAZIONI SPA) 23 Oc line 45 - column 3, line 2, figure 1	A, 4478882 (ITALTEL SOCIETA ITALIANA TELECOMMUNICAZIONI SPA) 23 October 1984, see column 2, line 45 - column 3, line 2, figure 1			
A	US, A, 4323593 (MATSUSHITA ELECTRIC 6 April 1982, see example 1; column 4, 1	, 4323593 (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO.) April 1982, see example 1; column 4, lines 44-65; figure 1			
"A" dos	pi categories of cited documents: 16 categories of cited documents: 16 cament defining the general state of the art which is not related to be of particular relevance lier document but published on or after the international	"I" later document published after to priority date and not in conflicted to understand the principl invention "X" document of particular relevant cannot be considered novel or	e or theory underlying the		
filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cled to establish the publication data of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or		cannot be canadored movel or involve an inventive all states "Y" document of particular relevan cannot be considered to involve decument is combined with one ments, such combination being	ce; the cisimed invention an invention step when the		
-5" 40	er mans summer published prior to the international filing date but ar them the priority date claimed	in the art. "A" document member of the same			
IV. CERTIFICATION Date of Mailing of this International Search Date of Mailing of this International Search					
	re Actual Carapistion of the international Search 3 July 1986 (28.07.86)	22 August 1986 (22,08.			
	nel Searching Authority OPEAN PATENT OFFICE	Signature of Authorized Officer			

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON

INTERNATIONAL APPLICATION NO.

PCT/DE 86/00165 (SA 12881)

ð

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 06/08/86

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR-A- 2551618	08/03/85	None	
US-A- 4478882	23/10/84	None	
US-A- 4323593	06/04/82	JP-A- 55138294	28/10/80

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 86/00165

I. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben)					
Nach der Internationalen Patenticlassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC					
Int. Cl 4					
IL REC	CHERCHIERTE SACHGEBIETE				
	Recherchierter N				
Klessifil	kationssystem	Klassifikationssymbole			
int. Cl.⁴	H US K				
	Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff g unter die recherchierte	ehörende Veröffentlichungen, soweit diese en Sachgebiere fallen			
IILEINS	SCHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN ⁹		13		
Art*	Kennzeichnung der Veröffentlichung ¹¹ , soweit erforderlich	unter Angabe der maßgeblichen Teile/4	Betr. Anspruch Nr. 13		
х	FR, A, 2551618 (COMPAGNIE D'I SPATIALE ET AERONAUTIQUE) Seite 4, Zeile 16 - Seite Abbildung 1	1,2			
_			3,5		
A			- •		
A	US, A, 4478882 (ITALTEL SOCIE TELECOMMUNICAZIONI SPA) 2 siehe Spalte 2, Zeile 45 Abbildung 1	1,6			
A	US, A, 4323593 (MATSUSHITA EI 6. April 1982, siehe Beis Zeilen 44-65; Abbidlung 1	3,4			
"A" Ver defi	iniert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	"I" Spätere Veröffentlichung, die nach den meldedatum oder dem Prioritätsdatum v ist und mit der Anmeldung nicht kollid Verständnis des der Erfindung zugrun	iert, sondern nur zum ideliegenden Prinzips		
tior	nalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	oder der ihr zugrundeliegenden Theorie	angegeben ist		
zwe fen:	"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung befagt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "Y" Veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" Veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" Veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" Veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" Veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betracht werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" veröffentlichung von besonderer 8 tet beruhend betrachter werden in "Y" ve		f erfinderischer Tatig- tung; die beenspruch-		
"O" Ver sind bez	O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, sine Berrutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Katebezieht wird und diese Verbindung für				
"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda- turn, aber nach dem beenspruchten Prioritatsdatum veröffent- licht worden ist					
IV. BESCHEINIGUNG					
Detum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts					
	Juli 1986	2 2 AUG 1986			
Inter	nationale Recherchenbehorde	Unterschrift des bevollmachtigten Bedlenste M. WAR MCL	mem (A)		
	Europäisches Patentamt				

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT UBER DIE

INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. PCT/DE 86/00165 (SA 12881)

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 06/08/86

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbe- richt angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffent- lichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffent- lichung
FR-A- 2551618	08/03/85	Keine	
US-A- 4478882	23/10/84	Keine	
JS-A- 4323593	06/04/82	JP-A- 55138294	28/10/80